PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04107559 A

(43) Date of publication of application: 09 . 04 . 92

(51) Int. CI

G03F 7/031

G03F 7/027

G03F 7/027

G03F 7/029

(21) Application number: 02228800

(22) Date of filing: 29 . 08 . 90

(71) Applicant:

KAO CORP

(72) Inventor:

II ATSUHIKO

MINAMI TAKAHIDE NAKAMURA KOICHI

(54) PHOTOSENSITIVE COMPOSITION AND CURED IMAGE FORMING METHOD USING THIS COMPOSITION

even by the subsequent irradiation with UV rays.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

(57) Abstract:

PURPOSE: To form latent images with a high sensitivity to visible light and to form the photoset images by full-surface irradiation with UV light in succession thereto by incorporating thioxantols, photosensitive resin and photoradical generator which are respectively specific.

CONSTITUTION: This compsn. contains the thioxantols which are expressed by formula I, the photosensitive resin having a photodimerizable group and the photoradical generator having the sensitivity with the visible light region. In the formula I, Z_1 and Z_2 may be the same or different and denote a benzo ring or naphtho ring which may have a substituent. The thioxantols are the corresponding thioxantols oxidized by the effect of the photoradical generator component by irradiation with visible light and play the role of a polymn. initiator for a curing reaction or a sensitizer. The latent images are formed in this way with the high sensitivity to the visible light. The excellent photoset images are formed without curing the parts except the latent images at all

集合をクリックすると一覧を10件単位で表示します。

DN : JP A2 4107559 (1992/04/09)

FAMILY MEMBERS

CC PUBDAT KD DOC.NO. CC PR.DAT YY PR.NO. JP 1992/04/09 A2 4107559 JP 1990/08/29 90 228800

<u>\$1</u>	IP	1
S2	Р	1
S3	U	0

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-107559

@Int.Cl."		識別記号	庁内整理番号	國公開	9 平成4年(1992)4月9日
G 03 F	7/031 7/027 7/029	5 0 4 5 1 1	9019-2H 9019-2H 9019-2H 9019-2H 卷查請求	未請求	請求項の数 4 (全13頁)

◎発明の名称 感光性組成物及びそれを用いた硬化像の形成方法

②特 頭 平2-228800

@出 願 平2(1990)8月29日

回発 明 者 中 村 浩 一 和歌山県和歌山市國部1030-13 回出 顯 人 花 王 株 式 会 社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

O代 理 人 弁理士 青山 葆 外2名

明細、春

1. 発明の名称

感光性組成物及びそれを用いた硬化像の形成方 注

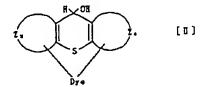
2. 特許請求の範囲

(1)(A)一般式、

[式中、 Z 、と Z 。は同一でも異なっていてもよく、置換基を有してもよいペンソ原又はナフト原を表す。]

で表されるチオキサントール類、

- (B)光2貫化が可能な基を有する感光性倒脂、 及び
- (C)可視光領域に感度を育する光ラジカル発生 剤を含有する感光性組成物。
 - (2)(D)一般式、



【式中、Dyeは、2、及び/又は2。に共有結合で結合し、それ自身の吸収液反の光を照射されたときに、光ラジカル発生剤に作用し、ラジカルを発生させる色素であり、2、及び2。は同一でも異なってもよく、Dye以外の観換基を有してもよいベンソ環又はナフト環を表す。〕

で表されるチオキサントール類、

- (B)光2量化が可能な基を有する感光性樹脂、 るび
- (E)光ラジカル発生剤

を含有する感光性組成物。

- (3)組成物が更に(F)アミン語を含有する請求 項(1)又は(2)記載の感光性組成物。
- (4)請求項(1)、(2)又は(3)記載の底光性組 成務からなる感光層に可視光を固像状に照射して

潜像を形成し、次いで紫外光で全面照射し、その 後現像を行う事を特徴とする光硬化像の形成方法。 3. 発明の詳細な説明

〈産業上の利用分野〉

本発明は、印刷版材等に有用な感光性組成物に 関する。特に本発明は、高感度を有する感光性組 成物に関する。

〈従来の技術〉

従来、原光性樹脂組成物の露光は紫外光で行われるのが主流であったが、近年レーザー光による デジタル記録技術の選歩に伴い、レーザー光を含む可視光による露先方法が広く投討されている。 例えば、アルゴンレーザー等の500mm近傍の可 視光を利用して、原光性樹脂膜に画像を形成する 試みがなされている。可視光で露光する場合には、 紫外光で露光する場合に比べて、露光時のエネル ギーが相対的に低下するために、より高感度な感 光性樹脂の開発が望まれている。

従来、可視光露光により高感度で光硬化像を得る方法として、主に重合型感光性樹脂を用いる方

イメージング・サイエンス[J. Jazz. Sci.]、3 0.5.215.1986)、及び同様の2段階露光による光重合像の形成方法(特公昭57-121 36号公報)等が提案されている。

しかしながら、このような方法に用いている化合物群では分光感度に重なりがあるために、可復光落光により潜像を形成した部分以外のところも、2段階目の紫外光で硬化してしまう。或は可視光増感剤と開始剤と変色成分が互いに独立しているために、潜像を形成する感度が低い等の欠点があり、実用的な方法は、未だ存在しないのが現状である。

また、光2重化型感光性樹脂を用いた方法では、 例えばマクロモレクラー・ヘミー「Makronol. Chas. J. 188,2973,1987に見られるように可視光増感剤との組合せによって可視光纖光である程度の高感度は達成しているもののまだ実用には不十分である。 〈発明が解決しようとする課題〉

本発明は、可視光に対し高感度で潜像を形成し、

法と光2畳化型感光性樹脂を用いた方法が検討されている。

重合型感光性別語を用いた方法では、電光する 光のエネルギーにより直接重合を開始する光重合 開始開系が用いられてきた。例えば特開昭60ー 22|403号におけるNーフェニルグリンと チオキサントン系色素との組合せからなる光重合 開始関却成物、特開昭59-45303号や特開昭62-81403号における育機過職化物と色素との組合せからなる光重合開始取成物、特開平2-85858号における 平2-69号や特別平2-85858号における ペキサナリールビイミダゾール化合物と色素との 組合せからなる光重合開始別組成物等がある。し かしながら、これらの方法では、光重合開始列系 の経度がすなわち感光性樹脂全体の感度になるた めに、原理的に感度に限界が生じる。

このような問題を解決する方法としては、可視 光による画像電光により先ず潜像を形成し、続く 処理工程で紫外光を全面照射して、前電光部分の み硬化させ、現像する方法(ジャーナル・オブ・

続く紫外光照射でも潜像以外の部分は全く硬化させないで、優れた光硬化像を形成できる感光性組成物、及びその光硬化像形成法を提供することを、目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明者等は上記目的を達成するため、鋭意検討の結果、光2度化型の感光性樹脂を用い且つ、感光性組成物中にチオキサントール類を配合すれば高感度が達成できることを見いだし、本発明を成すに至った。

即ち本発明は、

(A)一般式、·

(式中、 Z , と Z , は同一でも異なっていてもよく、 置換甚を有してもよいベンソ語又はナフト度を表す。)

で表されるチオキサントール類、

(B)光2量化が可能な基を有する感光性樹脂、及び

(C)可視光領域に感度を有する光ラジカル発生 制を含有する感光性組成物及びその光硬化像の形成方法を提供する。

また、本発明は

(D)一股式、

【式中、Dyeは、2.及び/又は2.に共有結合で結合している、それ目身の吸収放長の光を照射されたときに、光ラジカル発生剤に作用し、ラジカルを発生させる色素であり、2.及び2.は同一でも異なってもよく、Dye以外の置換基を有してもよいベンゾ環又はナフト環を表す。】で表されるチオキサントール類、

(B)光2量化が可能な蓋を育する感光性樹脂、

そのようなチオキサントール類(A)の具体例としては、チオキサンテンーターオール、1ーエチルチオキサンデンーターオール、2ープチルチオキサンテンーターオール、2ーペンチルチオキサンテンーターオール、2ーペナルチオキサンテンーターオール、2ーオクチルチオキサンテンー

及び

(E)光ラジカル発生剤

を含有する感光性組成物及びその光硬化像の形成 方法を提供する。

チオキサントール類(A)は、可視光照射により、 光ラジカル発生剤成分(C)の作用で酸化され、ま たチオキサントール類(D)は、可視光の照射によ り、光ラジカル発生剤成分(E)の作用で酸化され て、それぞれ対応するチオキサントン類になり、 これが紫外光による硬化反応の垂合開始剤又は増 感剤の役目を果たすものと考えられる。

チオキサントール類(A)としては、チオキサンテンー 9 ーオール(以下、単に「チオキサントール; と略す。)誘導体、並びに(ジ)ペンプチオキサントール誘導体等が挙げられる。

一般式[[]中、2,及び2,はチイン頃に結合した 置換蓋を有するベンソ環又はナフト環であり、同 一でも異なっていてもよい。芳香環上の置換蓋は 同一でも異なってもよく、又その置換蓋の種類、 数ともに特に限定されていないが、例えば、アル

9-オール、2ードデシルチオキサンテン-9-オール、2 - ペンタデジルチオキサンテンー9 -オール、2ーオクタデシルチオキサンテンー9ー オール、2ーテトラコシルチオキサンテンー9ー オール、2-iーブチルチオキサンテンー9ーオ ール、2-シクロペンチルチオキサンテン-3-オール、2ーシクロヘキシルチォキサンテン-9 -オール、2-(2-ブテニル)チオキサンテン-ターオール、2-フェニルチオキサンテン-9-オール、2~ペンジルチオキサンテン-9-ォー ル、3-i-プロピルチオキサンテン-9-オー ル、4ーメチルチオキサンテン-9ーオール、1. 2-ジメテルテオキサンテン-9-オール、1. 3-ジーiープロピルチオキサンテン-9-オー n、1,4-エテルチオキサンテン-<math>9-オール、 2.3-ジメテルチオキサンテン-9-オール; $2.4-\mathcal{V}-i-\mathcal{U}\mathcal{F}\mathcal{N}\mathcal{F}\mathcal{A}+\mathcal{U}\mathcal{F}\mathcal{N}\mathcal{F}\mathcal{N}-g-\mathcal{F}\mathcal{N}$ ール、2-5-プチルー4-メチルチオキサンテ ソーターオール、1,6ージー:-プロピルチオキ サンテン・9ーオール、1.8-ジメチルチオキ

サンテン-9-オール、2.5ージメテルチオキ サンテンーターオール、2.7ーLーブチルチオキ サンテンー9ーオール、3.5ージエチルチオキ サンテンーターオール、4.5ージエチルチオキ サンテンーターオール、3-プロピルー6-i-プロピルチォキサンテンー9ーオール、1.3.7 ートリメチルチオキサンテンー9ーオール、し 3.5.7ーテトラメチルチオキサンテンーターオ ール、7.8.9.10ーテトラヒドロー12H-ペンソ[b]チオキサンテンー12-オール、12 H-ベンソ[a]チオキサンテン-12-オール、 12H-ペンゾ[b]チオキサンテン-12-オー ル、7 Hーベンソ[c]チオキサンテンー7ーオー ル、1,9ージヒドロキシテオキサンテン、7ー メルカプトーターヒドロキシチオキサンテンー2 ーカルポン酸、3-プロポキシチオキサンテンー 9ーオール、3ー(メチルチオ)チオキサンテンー 9ーオール、2ー[(トリフルオロメチル)チオ]チ オキサンテン-9-オール、1-(メトキシメト キシ)チオキサンテン-9-オール、2-[2-[(9

.スルホン酸、9-ヒドロキシチオキサンテンー2 ースルフォン餃メチル、9-ヒドロキシチオキサ ンテンー2ースルフォン酸クロリド、7-Tミノ スルフォニルーターヒドロキシチオキサンテンー 2-カルボン酸、N,Nージメチルー9-ヒドロ キシチオキサンテンー2ースルフォナミド、3-ブチルスルフィニルチオキサンテンー9ーオール、 1-(9-ヒドロキシチオキサンテン-2-イル) プロパンーしーオン、9ーヒドロキシチオキサン テンー3ーカルポキサルデヒド、アクリル酸9ー ヒドロキシチオキサンテンー2-イル、9-ヒド ロキシチオキサンテンー4ーカルポニトリル、2 ーニトロチオキサンテンー 9 - オール、N - (7 ーヒドロキシー7H-ベンゾ[c]チオキサンテン -5-イル)アセトアミド、2ークロロー3ーフ ルオロチオキサンテンー9ーオール、3ープロモ チオキサンテンーターオール、1-ヨードチオキ サンチン-9-オール、I-(6-フルオロ-9 ーヒドロキシチオキサンテンー2-イル)-2.2. 2-トリフロロエタンー1-オン等が挙げられ、

ニヒドロキシチオキサンテン-2-イル]エトキ ゜ シ]エクンスルホン鼓、6-アミノ-7H-ベン ゾ[c]チオキサンテン~7~オール、11~アミ ノー6ーメチルー12H-ベンソ[6]チオキサン テンー12-オール、I-フェニルアミノー4-ニトロチオキサンテン-9-オール、2-(ジメ チルアミノ)チオキサンテン一9ーオール、3-エトキシーターヒドロキシチオキサンテンー4-カルポン酸エチル、9-ヒドロキシチオキサンテ ンー1ーカルボン酸ピニル、9-ヒドロキシチオ キサンテンー1ーカルボン酸ドデシル、9ーヒド ロキシチオキサンテンー【一カルポン酸オクタデ シル、9-ヒドロキシチオキサンテンー2.3:6. 7-テトラカルボン酸二無水物、9-ヒドロキシ チオキサンテンー 4 ーカルボン酸クロリド、 N。 N-ジメチル-9-ヒドロキシチオキサンテンー 1 ーカルポキサミド、7 ーエチルー9ーヒドロキ シチオキサンテンー3ーカルポキサミド、9-ヒ ドロキシチオキサンテンー3.4ーカルポキシミ ド、9-ヒドロキシチオキサンテン-2.7-ジ

これらを1種もしくは2種以上混合して使用できる。ただし、本発明に用いるチオキサントールの 誘導体は上記の例に限定されるものではない。

チオキサントール類(D)としては、チオキサン テン- g - オール誘導体、並びに(ジ)ペンゾチオ キサントール誘導体等が挙げられる。

そのようなものとしては、一般式

【式中、Dyeは、Z。及び/又はZ。に共有結合で結合している、それ自身の吸収波長の光を照射されたときに、光重合開始剤に作用し、ラジカルを発生させる色素であり、Z。及びZ。は同一でも異なってもよく、Dye以外の置換弦を有してもよいベンジ環又はナフト環を表す。】

で表される化合物が挙げられる。上記一般式 [[] 中、 Z 。及び Z 。は チィン 環に 結 環 した ベンソ 甲又

はナフト頭であり、同一でも異なってもよい。又 これらは頑上に少なくとも1つ以上の色素残益が 置換されているが、該色素残葢以外の置換基を有 してもよい。これら芳香原上の色素残基以外の置 換基は同一でも異なってもよく、又その置換基の 種類、数ともに特に限定されないが、例えばアル キル基、アリール基、アラルキル基、アルカリー ル基、アルケニル基、及びこれらの誘導体から選 ばれる基、又はそれらの2個以上の基が結合して いる環状構造であってもよい。『換する色素は、 具体的には4ーヒドロキシー2ー(6ーヒドワキ $\nu = 2, 4, 5, 7 - \mathcal{F} + \mathcal{F} = -\mathcal{F} + 3 - x + y - x$ 3 Hーキサンテンー9ーイル)安息香酸ジナトリ カム塩、9-(2-ヒドロキシフェニル)-3.6. ーピス(ジエチルアミノ)キサンテンチリウムクロ リポ等のキサンテン系色素、5ープミノー1,3. 3,1',3',3'ーヘキサメチルー2,2'ーインド ジカルポキシアニンパーオキシド等のシアニン系 色素、5-アミノー2-(4'ージメテルアミノシ ンナミリデン)ー1ーインダノン等のジアリール

ケトン系色素等が挙げられる。

そのようなチオキサントール類(D)のいくつかの例を以下に記す。

し、これを還元すればよい。チオキサンテン-9 ーオン誘導体中に、他に還元され得る官能甚を有 するときには、収率及び選択性を向上させるため に、適宜それらの官能甚を保護することも可能で ある。

本発明の2光量化が可能な基を有する原光性樹脂(B)は、例えばシンナモイル基、シンナミリデン基、カルコン技革、イソクマリン技革、2.5ージメトキシステルベン技革、ステリルピリジニウム残益、チミン技革、マレイミド技革、アントラセン技革、2ーピロン技革等の光2量化能を有する官能基を主観もしくは倒額中に含むオリゴマー、ポリマー等が挙げられる。その具体的な例を以下に示す。

これらを1種もしくは2種以上混合して使用できる。ただし、本発明に用いるチオキサントールの誘導体は上記の例に限定されるものではない。

尚、一般式 [1] および [1] で表されるチオキサントール類(A)および(D)は、例えば「ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー(J.Org.Chen.)32.2465(1967)」に示されているように、対応するチオキサンテンー9ーオン誘導体を遵元することにより合成できる。また、チオキサントール類(D)については、前述の色素分子内に存在する官能基(例えば水酸基、アミノ基)と、前駆体であるチオキサントン類上の官能基(例えば、1.5ージオキソー5ークロロベンチルアミノ基、1ークロロエトキシ基)との紹合反応により、チオキサントン骨格に色素残器を導入

a) R=CH, R'=CH, b) R=CH, R'=CH, c) R=H R'=C,R,

可視光に感度を有する光ラジカル発生剤(C)は、例えばラジカル開始剤もしくは2種以上の化合物からなるラジカル開始剤系であり、総説「ジャーナル・オブ・フェトポリマー・サイエンス・アンド・テクノロジー(J. Photopolya. Sci. Tecaol.)、Vol. 2. NO. 2. 279, 1989 J等に記載されている化合物を好きに用いることが出来る。例えば、1.3ージ(tープチルジオキシカルポニル)ペンゼン、3.3、4.4、一チトラキス(tープチルジオキシカルポニル)ペンゾフェノン等の有機過酸化物と可視光域に吸収をもつ各種色素の組合せ

や、可視光域に吸収をもつケトクマリン系やキサントン及びチオキサントン系の三重項増感剤と後述のアミン類(F)の組合せを用いてもよい。ただし、これらの例は本発明に用いることの出来るラジカルを発生する開始剤(C)を限定するものではない。

ラジカルを発生する光ラジカル発生剤(E)は、
2段階目の紫外光照射で直接ラジカルを発生する
ことが少ない開始剤であれば何でもよい。例えば、
記説『ジャーナル・オブ・フォトポリマー・サイ
エンス・アンド・テクノロジー(J. Photopolya.
Sci. Tecaol.), Vol. 2, NO. 2, 279, 198
9]等に記載されている化合物を好趣に用いることが出来る。例えば、1,3-ジ(tーブチルジオキシカルポニル)ベンゼン、3,3',4,4'ーテトラキス(tーブチルジオキシカルポニル)ベンゼン、1,3での有機過酸化物、ケトクマリン系やキサントン及びチオキサントン系の三重項増感剤と後述のアミン類(F)の組合せを用いてもよい。ただし、これらの例は本発明に用いることの出来るラジカ

必要に応じて、通常線状有機高分子からなるパイ ンダー、光重合促進剤、熱重合禁止剤、可塑剤等 の通常の添加剤を混合してもよい。パインダーに 用いる線状有機高分子体としては、光2量化が可 能な基を有する感光性樹脂(B)と相密性を有して いる線状有機高分子体である限り、どの様なもの を用いてもかまわない。具体的にはポリメククリ ル酸ニステル又はその部分加水分解物、ポリスチ レン、ポリ酢酸ピニル又はその部分加水分解物、 ポリビニルブチラール、ポリクロロブレン、ポリ 塩化ビニル、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリブ ロピレン、ポリビニルピロリドン、ポリビニルア ルコール、ポリエチレンオキシド、ポリメタクリ ル設又は側鎖にカルポキシル基を有するメタクリ ル鼓共重合体等が挙げられるが、これらに限られ るわけではない。

本発明の感光性組成物の組成に於いて、光2重化が可能な基を有する感光性樹脂(B)100重量部に対して、チオキサントール類(A)6しくは(D)の使用量は0.1~50部、钎ましくは0.5

ルを発生する開始前(E)を限定するものではない。

本発明の感光性組成物に於いては、特に紫外光 照射におけるラジカル発生効率を高める等の目的 のため、更にアミン類(F)を承加するのが好まし い。アミン類(F)としては、脂肪族及び/または 芳香族アミン類が挙げられる。具体的には、トリ プチルアミン、N. Nージメチルアニリン、トリ ベンジルアミン、pージメチルアミノ安息香酸ニ チル、pージメチルアミノ安息香酸プトキシエチ ル、pージメチルアミノ安息呑散アミル、pージメ チルアミノ安息香酸イソアミル、pージメチルア ミノ安息香酸、pージメチルアミノベンズアルデ ヒド、ミヘラーケトン(Michler's Ketone)、4, 4'ーピスジエチルアミノベンソフェノン、Nー フェニルグリシン、pークロルーN-フェニルグ リシン、ローメチルードーフェニルグリシン、ロー メトキシーN-フェニルグリシン等が挙げられる。 ただし、本発明に用いる脂肪族または芳香族でも ンは上記の例に限定されるものではない。

本発明の感光性組成物には前記各配合物に加え、

~15度量部、光ラジカル発生剤(C)もしくは(E)は0.1~10重量部、好ましくは0.5~5重量部の範囲内で用いられる。さらにアミン類(F)は、テオキサントール類1強量部に対して0.1~10重量部、特に0.5~5重量部の割合で使用することが好ましい。

本発明の感光性組成物の無製法は特に限定されないが、例えば上記各配合剤を遮光容器にて混合規律することにより行われる。

上記のようにして得られた本発明の感光性組成物を用いて、光重合像を形成する。形成法としては、例えば本発明の感光性組成物を適当な基板上に塗装した塗装板を乾燥後、オガフィルムを介して可視光を照射するか、若しくは可視光レーザーを変調して直接走査審光して潜像を作る。次いて無外光で全面露光を行った後、現像して光重合像を得る。

上記基板としては特に限定されず、例えばアルミ板、解板、ポリエチレン、ポリエステル等のブラスチックフィルム等であってよい。

塗装法も通常の方法でよく、例えばスピンナー、 或は種々のコーター類を用いることができる。 塗 膜の厚さは適宜選択されるが、例えば 0.1~1 0 μαである。

轮爆後可視光を照射する。可視光の波長は、使用する重合開始剤(C)の光吸収領域であればどのようなものでもよいが、感度が最も高い波長が好ましく、例えば400~850 saである。尚、鮮鋭な光重合像を得るために、適当なフィルターでカットしてもよい。光源としては水銀ランプ、キセノンランプ、ハロゲンランプ、レーザー光等を中(例えば、照射距離、照射時間、照射温度等)は特に限定されず、適宜選択してよい。又潜像を形成するためのネガフィルムも可視光を遮蔽するものであればよい。

上記可視光を照射した後、紫外光で全面照射する。紫外光の波長は適宜展択されるが、例えば200~400 naである。光原は上記のものを使用でき、又フィルターで単色光としてもよい。

〈発明の効果〉

以上のように、本発明の感光性組成物に於いては、可視光に対し高感度で潜像を形成し、続く集外光全面照射により光硬化像を形成することができる。また、本発明の感光性組成物を用いて得られる光硬化像は、非常に鮮災なパターン画像を有する。

〈実施例〉

以下、本発明を実施例で更に詳しく説明する。 尚、「部」は断わらない限り重量部を表す。

感光性組成物の調製と感度評価・

(実施例1~30)

表-1に示す組成のチオキサントール類(A)も しくは(D)、光2重化型感光性樹脂(B)100部、 アミン類(F)、光ラジカル発生剤、増感剤、更に 1000部の塩化メチレンを遮光下混合撹拌し、 感光性組成物を得た。 無外光照射により、壁痕は可視光露光部のみが 硬化する。即ちまガフィルムで覆われていた部分 は未硬化であり、この部分を通常の現像法、例え ば通当な溶剤で洗い流す等の方法で現像し、光硬 化像を得る。適当な溶剤としては、例えばエタノ ール、メチルセロソルブ、塩化メチレン等が挙げ られる。

〈作用〉

本発明の感光性組成物の硬化は、以下のような 機構であるものと考えられる。即ち、最初の可視 光照射により、光ラジカル開始剤(C)もしくは (E)の作用で租成物中のチオキサントール類は一 部酸化されて相当するチオキサントン類になる。 そして統く紫外光照射で、このチオキサントンが 複となって、残りの未酸化のチオキサントール類に (A)もくしは(D)が増殖的にチオキサントン類に 変換される。生成したチオキサントンが感光性複 指(B)の光2量化反応の増盛剤の役目を果たし、 感光性組成物の硬化を高度に進めるものと考えられる。

전 2 4 0		#	K & C + + + + + + + + + + + + + + + + + +
- -		#	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- -	2 2 2 2 - 2 2 2 2 C C C		**************************************

-		**************************************	**************************************
_		4046440400448004	

_		# 12 + 4 0 4 0 0 4 4 10 0 4 4 10 0 4 4 10 0 4 4 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
_		**************************************	21 27 27 27 27 27
_		**************************************	
_		**************************************	**************************************
		**********	**************************************
		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	**************************************
		2 4 4 2 2 4	N 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
_		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		2 C C C	1 1 5 55 5 50
_		5 5	5 2
•		7 5	
-		_	10 54
		5.4	8 5.4
•		2.4	8 54
-		5.5	5 5
a 0		2 5	9 2 8
8		2.4	2.4
~		5.4	5.4
6		2.4	9 2 4
•0		5.5	- 55
7		5.4	6 54
7		5 2	5 5 5
90		5.4	5 5
*7		5.4	6 54
0		5 4	6 54

! 化合物	化合物
No.	
: 1	ナオキサンテンーターオール
2] - エチルチオキサンテン- 9 - オール
3	2-シクロヘキシルチオキサンテンー9-
	オール
; 4	2-フェニルチオキサンテンーターオール
5	2-ベンジルチオキサンテン-9-オール
6	2.4-ジーiーペンチルテスキサンテン
	-9-x-n
7	3ープロピルー6ー1ープロピルチオキサ
	ンテンー9ーオール
8	12H-ペンプ[b]チオキサンテンー12
	ー ナール .
9	1,9-ジヒドロキシチオキサンテン
10	3-プロポキシチオキサンテン-9-オー
}	1b
111	1-(メトキシメトキシ)テオキサンテンー
	ターオール
1 2	6-アミノー7H-ペンソ[c]チオキサン
-	テンーフーオール
13	3-エトキシー9-ヒドロキシチオキサン
	テンー4ーカルボン酸エチル
14	9-ヒドロキシチオキサンテン-2.3:6.
1	7ーテトラカルボン酸二無水物
15	9-ヒドロキジチオキサンチンー4ーカル
-	ポン酸クロリド

化合物	化合物 ''
Nò.	<u> </u>
16	N, N-ジメナルーターヒドロキシテオキ
• •	サンテンー!ーガルポチサミド
17	9ーヒドロキシチオキサンテンー2.7ー
	ジスルホン酸
18	ターヒドロキシチオキサンテンー2ースル
	フェン酸メチル・
19	1 −(9 −ヒドロキシチオキサンテン−2
	ーイル)プロパンー1-オン
20	g-ヒドロキシチオキサンテン-3-カル
	ポキサルアヒド・・・:
2 1	9-ヒドロキンチオキサンテンー4ーカル
_	ポニトリル
2 2	2-ニトロチャキサンテン-9-オール
2 3	2-フロローフルオロチオキサンテン-9
_ ,	-オール
	1 01 00については 下口の久存

化合物 No. 24~39については、下記の各様

造の化合物である。

化含物No.24

化合物No.28

化合物 No. 26

化合物No.29

化合物No.27

化合物No.30

化合物 No. 3 2

化合物No.40~53については、下表の各化

合物である。

= 1/4 = -> -	
化合物	化合物
No.	
40	トリプチルアミン
41	N, N ージメチルアニリン
4 2	トリベンジルアミン
43	p-ジメチルアミノベンゾイックアシッド
i i	エチルエステル
44	p-ジメチルアミノベンゾイックアシッド
!	ブトキシエチルエステル
4.5	p- ジメチルアミノベンゾイックアシッド
	アミルエステル
4 6	p-ジメチルアミノベンゾイックアシッド
4 7	p-ジメチルアミノベンズアルデヒド
4 8	ミヘラーケトン
4 9	4.4'ーピスジエチルアミノベンゾフェノ
	ν .
5 0	N-フェニルグリシン
5 1	pークロズルーN-フェニルグリシン
5 2	a-メチルーN-フュニルグリシン
5 3	p-メトキシ-N-フェニルグリシン

化合物No.54~No.69については、下記各

構造の化合物である。

化合物	X	R'	R *	R *	Y
5 6	S	OC.H.	н	H	BF.
5 7	S	OC.H.	н	Н	BF.
5.8	! s	OC.H.	OCH.	осн.	BF.
5 9	S	н	OCH	OCH,	BF.
60	S	N(CH,)	Н	Н	C10.
61	0	OC.H.	н	Н	S b F .

(化合物 No. 6 2)

(化合物No.63)

(化合物 No. 64)

(化合物 No. 5 4)

(化合物No.55)

(化合物No. 56~No. 6 I)

但し各化合物(No.56~61)は、上記構造式中 R¹~R³及びXとYが下表のように対応するもの である。

(化合物 No. 65)

(化合物No.66)

(化合物 No. 67)

(化合物 No. 68)

(化合物 No. 69)

レリーフ版の作製及び感光性組成物の感度副定

実施例1~30の各感光性組成物を陽極酸化したアルミ板上に乾燥原が約14mになるようにスピンナーを用いてそれぞれ塗布した。次いでこれらの乾燥原に面像パクーン(ネガフィルム)を通して可視光を照射し、次にネガフィルムを剝がして無外光で全面露光した。尚、可視光及び紫外光は高圧水銀灯又はキセノンランプ(ウシオ電気(株)数)に可視光及び紫外光干渉フィルター(朝日分光(株)数)を用いてほぼ単色光にして使用した。その後エタノールにより未硬化部分を溶出してレリーな液で染色することにより深度の形で露光したのに必要な、第一段階の可視光の最低照射エネルギーを測定して、その相対値により感度を表した。こ

れらの結果を表一1に示す。尚、風射エネルギーの創定は安藤電気(株)製光パワーメーターにて行い、相対感度を下式に従って求めた。

(各最低照射エネルギー)

相対感度= (実柱例28の最低照射エネルギー)

特許出願人 花 王 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 青山 葆 (ほか2名)